【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】令和6年11月29日(2024.11.29)

【国際公開番号】WO2023/181928
【出願番号】特願2024-509969(P2024-509969)
【国際特許分類】
Ｈ０１Ｌ 21/304(2006.01)
Ｃ０９Ｋ 3/14(2006.01)
Ｃ０９Ｇ 1/02(2006.01)
Ｃ０８Ｋ 3/36(2006.01)
Ｃ０８Ｌ 1/04(2006.01)
Ｃ０８Ｌ 29/04(2006.01)
Ｃ０８Ｌ 33/26(2006.01)
【ＦＩ】
Ｈ０１Ｌ 21/3046２２Ｄ
Ｈ０１Ｌ 21/3046２２Ｃ
Ｃ０９Ｋ 3/14 ５５０Ｚ
Ｃ０９Ｋ 3/14 ５５０Ｄ
Ｃ０９Ｇ 1/02
Ｃ０８Ｋ 3/36
Ｃ０８Ｌ 1/04
Ｃ０８Ｌ 29/04
Ｃ０８Ｌ 33/26

【手続補正書】
【提出日】令和6年8月28日(2024.8.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
砥粒としてのシリカ粒子と、塩基性化合物と、水と、第１の水溶性高分子としてのセルロース誘導体と、第２の水溶性高分子としてのポリビニルアルコール系ポリマーと、第３の水溶性高分子としての窒素原子を含有するポリマーとを含み、
前記第２の水溶性高分子の含有量Ｃ２と前記第３の水溶性高分子の含有量Ｃ３との合計含有量に対する前記第１の水溶性高分子の含有量Ｃ１の比（Ｃ１／（Ｃ２＋Ｃ３））が、重量基準で０．１以上である、研磨用組成物。
【請求項２】
前記第２の水溶性高分子の含有量Ｃ２に対する前記第３の水溶性高分子の含有量Ｃ３の比（Ｃ３／Ｃ２）が、重量基準で０．０５以上５未満である、請求項１に記載の研磨用組成物。
【請求項３】
前記第１の水溶性高分子の含有量Ｃ１と前記第２の水溶性高分子の含有量Ｃ２との合計含有量に対する前記第３の水溶性高分子の含有量Ｃ３の比（Ｃ３／（Ｃ１＋Ｃ２））が、重量基準で０．１８以上１０未満である、請求項１または２に記載の研磨用組成物。
【請求項４】
前記シリカ粒子は、平均アスペクト比が１．０以上３．０以下である、請求項１または

２に記載の研磨用組成物。
【請求項５】
前記第３の水溶性高分子の重量平均分子量は５万以上である、請求項１または２に記載の研磨用組成物。
【請求項６】
前記第３の水溶性高分子は、アクリロイルモルホリン系ポリマーである、請求項１または２に記載の研磨用組成物。
【請求項７】
前記第１の水溶性高分子の含有量Ｃ１、前記第２の水溶性高分子の含有量Ｃ２および前記第３の水溶性高分子の含有量Ｃ３は、重量基準で以下の関係：
Ｃ１＜（Ｃ２＋Ｃ３）
を満たす、請求項１または２に記載の研磨用組成物。
【請求項８】
シリコン材料からなる表面の研磨に用いられる、請求項１または２に記載の研磨用組成物。
【請求項９】
請求項１または２に記載の研磨用組成物の濃縮液。